

SE-102

Surfiler



小型机器便能检测样品表面的薄膜厚度 Thickness distribution measuring compact ellipsometer

可达成表面点/线分布测量的小型高速椭圆偏光仪，最适合用于数mm狭窄区域的膜厚/双折射分布检测。

Single point, line and area measurement. SE-102 provides analysis of the distribution of thickness and diffractive index in narrow area of several mm square.

- 高速表面测量 High-Speed Mapping Measurement
- 图表功能 Graph Function
- CSV数据输出 CSV Format Export
- 3D显示功能 3-D View Function
- 内建PCA传感器 PCA Sensor equipped

小机器却拥有多功能检测

Multi measurement functions in compact body

可轻易转换 点/线/面 三种测量模式

Single point, line and area measurement.

SE-102含有1个马达转动载台，不仅点的测量甚至线的测量或者更微小的面积测量皆可完成。The combination of high-density PCA sensor and a moving stage realizes line and area measurement.

点测量 Single point measurement

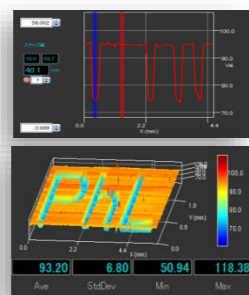
允许最长1/70秒间隔的实时测量。可分析膜厚的时间变化。Real-time measurement at 70 fps rate is available. Then film thickness gradual change can be observed real-time.

线测量 Line measurement

5秒的时间便可完成100点/0.2mm间隔的数据检测。Thickness data of 100 points at 0.2 mm interval is available within 5 seconds.

面测量 Area measurement

扫描测量范围可达宽度2mm以及长度10mm。另外，此机器亦拥有十分惊人的高速检测性能，因此，仅需1分钟便可输出1万点以上高分辨率的面测量数据。Scanning measurement of 2 mm x 10 mm areas, more than 10,000 points in less than one minute!



SE-101

体积小、功能性高的点测量设备 Compact and high extensibility ellipsometer for point measurement

体积小、操作简单并且内含倾斜感应器，是一台价格低且容易结合于其他系统的量测设备。

Compact, low price, easy operation, tilt-sensor included. Easy incorporation to other systems.

- 输出CSV数据 CSV Format Export
- 内建PCA传感器 PCA Sensor equipped

高速测量

High-Speed Measurement

允许最长1/70秒间隔的实时测量。可分析膜后的时间变化。Real-time measurement as fast as 70 fps is available. Then film thickness gradual change can be observed real-time.

多功能性

High Extensibility

机器的头部组件取下之后，可拿来当组件模块使用。Removable head unit can be used as a module.



产品规格

	ME-210	ME-110	SE-102 Surfiler	SE-101
测量方式 / Measurement Method	PCA(PHL晶体数组并行处理)方式 Photonic Crystal Array Parallel Processing Method			
量测再现性 / Measurement Repeatability	膜厚: 0.1nm 折射率: 0.001※ Thickness: 0.1nm, Refractive Index: 0.001※			
光源 / Light Source	半导体雷射 (typ. 636 nm) Semiconductor Laser (typ. 636nm)			
量测点 / Measurement Spot	广域模式: 0.55mm角 普通模式: 55µm角 高画质模式: 5.5µm角 Wide-Range mode: 0.55mm square Middle-range mode: 55µm square High-resolution mode: 5.5µm square	0.55mm角 0.55mm square	点/线测量: 0.5mm角 面测量: 0.1mm角 Point/Line mode: 0.5 mm square Area mode: 0.1 mm square	约 1.0 mm角 Approx. 1.0 mm square
入射角 / Angle of Incidence	标准70度 Standard 70 degree			
载台尺寸 / Stage Size	可检测最大81inch的晶圆 Max. Sample Diameter: 8 inch		可检测最大44inch的晶圆 Max. Sample Diameter: 4 inch	
测量速度 / Measurement Speed	最快每分钟20,000点以上 (高画质模式测量时) Max >20,000 points/min (High resolution measurement)	最快每分钟1,000点以上 Max >1,000 points/min	最快每分钟10,000点左右 (面测量时) Max ≈10,000 points/min (Area measurement)	约 0.1秒 / 1测量点 Approx. 0.1sec
主机尺寸 / Main Body Size	宽度 (Width) 650 mm 深度 (Depth) 650 mm 高度 (Height) 1740 mm	650 mm	宽度 (W) 300 mm 深度 (D) 235 mm 高度 (H) 258 mm	宽度 (W) 250 mm 深度 (D) 175 mm 高度 (H) 220 mm
重量 / Weight	约 120kg / Approx.120 kg		约 9.0kg / Approx.9.0 kg	约4.0kg / Approx. 4.0 kg
产品内容 / Product Includes	系统 * 1 软件 (安装 CD) 标准样品、操作说明书		System, Desktop PC, Software (Installation CD) Reference Sample, Manual	

※此量测再现性的是重复测量100次Si上的SiO2膜(膜厚约100nm)所产生的标准偏差值。

Standard deviation of the 100 repeatedly measurement of SiO2 (about 100 nm thickness) on Si.

※ 为了改善质量，无事先告知便更改规格的情况，敬请见谅。

Specifications are subject to change without any notice on the part of the manufacture.

2014. 04版



株式会社フォトニックラティス
Photonic Lattice, Inc.

〒989-3204 宮城県仙台市青葉区南吉成6丁目6-3 ICR 2F
TEL: 022-342-8781 FAX: 022-342-8782
ICR 6-6-3 Minami-Yoshinari, Aoba-ku, Sendai city, Miyagi,
989-3204 JAPAN
Phone: +81 22 342 8781 Fax: +81 22 342 8782
e-mail: sales@photonic-lattice.com
URL: http://www.photonic-lattice.com



株式会社フォトニックラティス